

セラミックス製造技術の最新動向

日時 令和8年6月17日(水) 14:00~16:30

場所 石川県工業試験場 5階
石川トライアルセンター 第2研修室

講師 グループ長 嶋村 彰紘 氏
上級主任研究員 近藤 直樹 氏
主任研究員 且井 宏和 氏
国立研究開発法人産業技術総合研究所
中部センター マルチマテリアル研究部門

【概要】

セラミックス材料は、半導体やエネルギー、環境分野など、さまざまな産業で広く使われており、その性能は製造プロセス技術によって大きく左右されます。近年、製品の高性能化や安定した生産を実現するため、製造技術の重要性はますます高まっています。

本講演では、セラミックスの高性能化や安定生産に役立つ最新の製造技術について、造粒、鋳込み成形、3D 積層造形、CVD 膜形成といった代表的なプロセスを取り上げ、それぞれの特徴や最新の動向、実際の応用事例をわかりやすく解説します。

定員 20名程度

受講料 1,000円 (当日ご持参ください。)

お申込み 下記の URL からお申込みください。

<https://www.isico.or.jp/event/dgnet/d31193528.html>

締切 令和8年6月10日(水)

担当 石川県工業試験場 化学食品部 研究員 竹田大樹

お問合せ 公益財団法人 石川県産業創出支援機構
成長プロジェクト推進部 次世代講座担当
〒920-8203 金沢市鞍月2丁目1番地(石川県工業試験場 企画指導部内)
E-mail: j-seminar@isico.or.jp TEL:(076)267-8081

主催 公益財団法人 石川県産業創出支援機構

協力 石川県工業試験場

